



دانشکده فیزیک

گرایش جامد

عنوان :

مطالعه تجربی خواص فیزیکی لایه های نازک و نانو ساختارهای اکسید نیکل و ترکیبات آلایشی آنها.

نگارش :

معصومه نجفى

استاد راهنما :

دکتر حسین عشقی

پایان نامه کارشناسی ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

بهمن ۱۳۹۲

تقديم بابوسه براستوارترين تكيه گانهم، دستان پر مهر پدرم و سنرترين تخاه زندگيم تخاه مهربان مادرم كه شوق زیبای نفس کشیدن است. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن رامعنا کردند. پروردگارا توفیقم ده که هر نخطه شکرکذارشان باشم و ثانیه ای عمرم را در عصای دست بودنشان بکذرانم.

م سکر وقدردانی

سپاس بیکران پروردگارراکه،متیمان بخشد و به طریق علم و دانش ر ^بنمونمان شد و به بهم نشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم ومعرفت را روزیان ساخت. برخودلازم می دانم که از اساد کرانقدرم جناب آقای دکتر حسین عثقی بابت تام محک دو را مهایی دی ایثیان که در طی این مسیر نسبت به من داشةا مُدكحال مُشكر را داشة باشم ، و از خداو مُدمتعال توفيق روز افزون اين بزر كوار را خواسارم .

واز تام دوسان و بهم کلاس به ی عزیزم به خاطر کمک با وحایت بایشان سپاسکزارم و موفقیت بای بیشتر در زندگی را برایشان آ رزومندم .

تعهدنامه

اینجانب معصومه نجفی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیک حالت جامد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایاننامه: مطالعه تجربی خواص فیزیکی لایه های نازک و نانو ساختارهای اکسید نیکل و ترکیبات آلایشی آنها تحت راهنماییدکتر حسین عشقی; متعهد می شوم:

تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.

 در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.

 مطالب مندرج در پایاننامه تا کنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.

 کلیه حقوق این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود میباشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه صنعتی شاهرود» و یا « Shahrood University of Technology » به چاپ خواهد رسید.

 حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایاننامه تاثیرگذار بودهاند در مقالات مستخرج از پایاننامه رعایت می گردد.

در کلیه مراحل انجام این پایاننامه، در مواردی که از موجودات زنده (یا بافتهای
 آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.

در کلیه مراحل انجام این پایاننامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد
 دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
 تاریخ

امضای دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر

- کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامههای رایانهای، نرمافزارها و تجهیزات ساخته شده) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
 - استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.



ما در این پایان نامه به مطالعه مورفولوژی، خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی نمونههای متشکل از نانو ذرات اکسید نیکل خالص و آلایش یافته با مس و لیتیم رشد داده شده به روش اسپری پایرولیزیز پرداخته ایم. برای بررسی مورفولوژی، خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی بترتیب از دستگاه های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیفسنجی، طیف نگاری نوری (UV-Vis.-NIR)، مشخصهیابی V-I و اثر سیبک استفاده کردیم.

در نمونه های رشد یافته از پودر کلرید نیکل شش آبه به منظور تهیه محلول اسپری استفاده شده است. پارامترهای مورد بررسی ما در این تحقیق عبارتند از: حجم محلول، آهنگ لایه نشانی به همراه بازپخت آنها در حضور هوا، و سرانجام آلایش نمونه ها با اتم های مس (NiO:Cu) و لیتیم (NiO:Li).

کلید واژهها: اکسید نیکل، اسپری پایرولیزیز، نانو دانه ها، مورفولوژی، خواص ساختاری، خواص اپتیکی، خواص الکتریکی، خواص ترموالکتریک.

لىيت مقالات متخرج ازيايان نامه

 ۱. نجفی، معصومه؛ عشقی، حسین، (۱۳۹۲) « بررسی تاثیر حجم محلول بر خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختار های اکسید نیکل تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز »، کنفرانس سالانه فیزیک ایران-دانشگاه بیرجند، ص ۸۴۶–۸۴۳.

2. Najafi, Masoomeh; Hosein, Eshghi, (2013), "The Effect of deposition rate on morphological, structural and optical properties of nanostructured NiO thin films prepared by spray pyrolysis technique", 16th Iranian Physical Chemistry Conference University Of Mazandaran Babolsar, p 490-492.

3. Najafi, Masoomeh; Hosein, Eshghi, (2014), "Effect of Cu doping on physical properties of nanostructured NiO thin films prepared by spray pyrolysis technique", 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5), Kish Island, Iran.

. فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱ فصل اول: مروری بر مقالات و مقدمه ای بر ویژگی پای ساختاری ، الکتریکی و پندیکی لایه پای نازک اکسید شکل

۲		مقدمه
۲	اكسيد نيكل	1-1
۲	۱-۱ ساختار اکسید نیکل	- 1
۴	۱ –۲ خواص فیزیکی	- 1
۴	۱–۳خواص الکتریکی	- 1
۴	بلورهای نیمرسانا	۲-۱
۶	لايەھاى ناز ک اكسيد نيكل	۳-۱
۷	خصوصیات فیزیکی لایه نازک تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز	4-1
۷	۴-۱ بررسی اثر حجم محلول	- ١
۱۲	۴-۲بررسی اثر آهنگ لایه نشانی	- 1
۱۵	۴-۳بررسی اثر آلایش با مس	- \
۱۸	۴-۴ بررسی اثر آلایش با لیتیم	- \
	۲ فصل دوم : معرفی روش پهی مشحضه یابی لایه پهی مازک	

مقدمه..... ۲۶ میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدانی.....

۲۷	پراش پرتو ایکس	۲-۲
۲۹	ضخامت سنجى نمونهها	۳-۲
٣٠	طیف نگاری عبور و بازتاب اپتیکی	4-1
۳۱	۴–۱ ضریب جذب	-7
۳۱	۲-۲ گاف نوارۍ۴	-7
۳۱	خواص الكتريكي	۵-۲
۳۲	خواص ترموالکتریک (اثر سیبک)	۶-۲
بازک اکسید شکل به روش اسپری پایرولنزیز	۳ ^{فص} ل سوم : مراحل آ زمایشگاهی رشد لایه ا ی	

۳۶		مقدمه
۳۶	روشهای رشد لایههای نازک اکسید نیکل	۱-۳
۳۶	دستگاه اسپری پایرولیزیز	۲-۳
۳۸	۲-۱ آماده سازی زیرلایه	۳_
۳۸	۲-۲آماده سازی محلول مورد نیاز برای تهیه نمونهها	۳_
۴۰	۲-۳ پارامترهای لایه نشانی	۳_
اکسید شکل	۶ ۶ فصل چهارم : نتایج و بحث در مورد مورفولو ژی، خواص ساختاری، اپنیکی والکتریکی لایہ مازک مانو ساختار	

۴۲	مقدمه
۴۲	۱-۴ بررسی اثر حجم محلول بر خواص فیزیکی لایههای نازک نانو ساختار NIO
۴۲	الف) مطالعه مورفولوژی سطح لایهها
۴۳	ب) مطالعه خواص ساختاری لایهها
۴۵	ج) مطالعه خواص اپتیکی لایهها

۴۷	د) مطالعه خواص الکتریکی و ترموالکتریکی لایهها
۴٩	۲-۴ بررسی آهنگ لایه نشانی بر خواص فیزیکی لایههای نازک نانو ساختار NIO
۴٩	الف) مطالعه مورفولوژی سطح لایهها
۵۰	ب) مطالعه خواص ساختاري لايهها
۵۲	ج) مطالعه خواص اپتیکی لایهها
۵۴	د) مطالعه خواص الکتریکی و ترموالکتریکی لایهها
۵۶	۴-۲-۱ بررسی اثر بازپخت بر خواص فیزیکی لایههای نازک نانو ساختار NiO
۵۶	الف) مطالعه مورفولوژی سطح لایهها
۵۷	ب) مطالعه خواص ساختاری لایهها
۵۸	ج) مطالعه خواص اپتیکی لایهها
۶۰	۴-۳ بررسی اثر آلایش مس بر خواص فیزیکی لایههای نازک نانو ساختار NIO
۶۰	الف) مطالعه مورفولوژی سطح لایهها
۶۰	ب) مطالعه خواص ساختاري لايهها
۶۴	ج) مطالعه خواص اپتیکی لایهها
<i>99</i>	د) مطالعه خواص الکتریکی و ترموالکتریکی لایهها
۶۷	۴-۴ بررسی اثر آلایش با لیتیم بر خواص فیزیکی لایههای نازک نانو ساختار NIO
۶۷	الف) مطالعه خواص ساختارى لايەھا
۶۹	ب) مطالعه خواص اپتیکی لایهها
۷۳	متیجه کسری متیجه کسری
γγ	مراحع

فهرست شكل د

ئتار مکعبی اکسید نیکل[۴]	شکل ۱-۱: ساخ
عتار ششگوشی اکسید نیکل[۸]۳	شکل ۱-۲: ساخ
ح رسانندگی ذاتی در نیمرسانا[۱۶]	شکل ۱-۳: طر <u>-</u>
ل XRD نمونههای تهیه شده در حجمهای متفاوت[۲۹]	شکل ۱-۴: طيف
برات جذب اپتیکی بر حسب طول موج برای همه نمونهها[۲۹]۹	شکل ۱-۵: تغیی
برات گاف نواری نمونههای تهیه شده در حجمهای متفاوت[۲۹]	شکل ۱-۶: تغیی
برات lnp برحسب عکس دما[۲۹]	شکل ۱-۷: تغيي
برات emf بر حسب اختلاف دمایی (ضریب سیبک)[۲۹]	شکل ۱-۸: تغیی
برات مقاومت ویژه لایههای اکسید نیکل تهیه شده با آهنگهای متفاوت[۳۰]	شکل ۱-۹: تغیی
ودار تغییرات طیف عبور (🖈، ضـخامت (+)، ضـریب شکسـت (•) و گـاف نـواری (*)	شکل ۱-۱۰: نم
نیکل با آهنگهای متفاوت لایه نشانی[۳۰]	لايەھاي اكسيد
ماویر SEM نمونههای تهیه شده با آهنگهای متفاوت[۳۱]	شکل ۱-۱۱: تص
یف عبور و بازتاب لایههای نازک اکسید نیکل با آهنگهای لایه نشانی متفاوت[۳۱].۱۵	شکل ۱-۱۲: ط
نوی XRD نمونههای آلایش شده با مس[۳۲]	شکل ۱-۱۳: الگ
ودار تغییرات مقاومت در واحد طول بر حسب دما برای نمونـه خـالص اکسـید نیکـل و	شکل ۱-۱۴: نم
، س[۳۲]	آلایش یافته با ه
ودارهای (a) طیف جذب و (b) طیف عبور نمونـههـای خـالص اکسـید نیکـل و آلایـش	شکل ۱-۱۵: نم
۱۷[۲	یافته با مس[۲
ودار تغییرات ² (αhυ) بر حسب hv نمونههای با درصدهای وزنی متفاوت مس[۳۲]۱۸	شکل ۱-۱۶: نم
بف های XRD لایه های NiO آلایش یافتـه بـا Li (%wt) نشـان دهنـده رشـد در	شکل ۱-۱۷: طب

۱۹	جهت ترجيحی (۱۱۱)[۱۵]
۲۰[۱۵](B-F)(۱–۵ wt.۹	شکل ۱-۱۸: تصاویر SEM نمونههای خالص(A) و آلایش یافته با لیتیم (۵
۲۰	شکل ۱-۱۹: طیف عبوری NiO آلایش یافته با Li (%wt ۵-۰)[۱۵]
۲۱[۱۵](۱–۵ wt%) Li	شکل ۱-۲۰: گاف نواری مستقیم نمونههای NiO خالص و آلایش یافته با
-۰) Li در دمای اتاق[۱۵].	شکل ۱-۲۱: تغییرات مقاومت ورقهای و ویژه NiO آلایش یافته با (۵wt%
۲۱	
NiO:Li (7 · at%) (c) .Ni	شکل ۲-۲۲: طیفهای XRD لایههای: (a) خـالص، (b) (%O:Li (۱۰ at
NiO:Li (۶۰ at%) (g)،	,NiO:Li (δ at%) (f) ,NiO:Li (f at%) (e) ,NiO:Li (f at%) (d)
۲۲	[٣٣]NiO:Li (۱۰۰ at%) (i) ،NiO:Li (۸۰ at%) (h)
(d) .NiO:Li (Y • at%) (c)	شکل ۱-۲۳: تصاویر SEM نمونه خالص (a) و (b) (NiO:Li (۱۰ at%) و NiO:Li (۱۰ at%)
۲۳	[٣٣](۵۰ at%) (f) ،NiO:Li (۴۰ at%) (e) ،NiO:Li (۳۰ at%)
74[77](+-1++	شکل ۱-۲۴: طیف عبور اپتیکی نمونه خالص و آلایش یافته با لیتیم (at%
ليتيم[٣٣]ل	شکل ۱-۲۵: نمودار ² (αhv) بر حسب hv نمونههای خالص و آلایش یافته و
) دانشگاه تهران	شکل ۲-۱: دستگاه میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدانی (FESEM
۲۸	شکل ۲-۲: بازتاب اشعه ایکس برای تعیین فاصله بین صفحات[۳۶]
۲۸	شکل ۲-۳: دستگاه پراش پرتو X مدل Bruker-AXS در دانشگاه دامغان
هرود	شکل ۲-۴: دستگاه اندازهگیری ضخامت سطحی لایهها دانشگاه صنعتی شا
ى شاھرود	شكل ۲-۵: دستگاه اسپكتروفومتر (Shimadzu UV-1800) دانشگاه صنعت
۳۳	شکل ۲-۶.:طرح شماتیک گرفتن ولتاژ با استفاده از روش اثر سیبک
۳۷	شکل ۳-۱: روشهای رشد فیزیکی و شیمیایی
ده شده بـرای تهیـه لایـههـا	شکل ۳-۲: دستگاه اسپری (Spray Coating System.S.C.S.806) استفاد
۳۸	اکسید نیکل در دانشگاه صنعتی شاهرود

٣٩	شکل ۳-۳: محلول کلرید نیکل شفاف برای لایه نشانی
، متفاوت ۲۰، ۳۰ و ۴۳۵۰ m	شکل ۴-۱: مورفولوژی سطح نمونههای اکسید نیکل خالص با حج _م های
$(\delta \cdot) $ ml $\mathcal{V}2 (\mathcal{V} \cdot) \mathcal{V}1 (\mathcal{V} \cdot)$	شکل ۴-۲: طیف XRD نمونه های NiO خالص در حجم هـای متفـاوت
۴۴	V3
نمونههای با حجمهای متفاوت	شکل ۴-۳: طیف عبور و بازتاب لایه های نازک اکسید نیکل خالص برای
۴۶	
، های رشد یافته اکسـید نیکـل	شکل ۴-۴: تغییرات ضریب جذب اپتیکی بر حسب طول موج برای نمونه
۴۶	خالص با حجمهای متفاوت (۲۰) V1، (۳۰) V2و ml (۵۰) V3
اری اپتیکی بـر حسـب حجـم	شکل ۴-۵: الف) منحنی ² (hva) بـر حسـب hv، ب) تغییـرات گـاف نـو
۴۷	محلولهای متفاوت (۲۰) V1، (۳۰) V2و M1 (۵۰) V3
فاوت (۲۰) V1، (۳۰) V2و ml	شکل ۴-۶ : نمودار I-V نمونه های اکسید نیکل خالص با حجم هـای مت
۴۸	
۴۸ صالص با حجمهای متفاوت	(۵۰) V3 شکل ۴-۲: نمودار ولتاژ- دما (اثر سیبک) برای نمونههای اکسید نیکل خ
۴۸ صالص بـا حجـمهـای متفـاوت ۴۹	(۵۰) V3. شکل ۴-۲: نمودار ولتاژ- دما (اثر سیبک) برای نمونههای اکسید نیکل خ (۲۰) V1، (۳۰) V2و ۵۱ (۵۰) V3
۴۸ صالص بـا حجـمهـای متفـاوت ۴۹ لايـه نشـانی متفـاوت (۵) R1،	(۵۰) V3. شکل ۴-۷: نمودار ولتاژ- دما (اثر سیبک) برای نمونههای اکسید نیکل ۲ (۲۰) V1، (۳۰) V2و M1 (۵۰) V3 شکل ۴-۸: تصاویر SEM نمونههای اکسید نیکل خالص با آهنـگهـای
۴۸ فالص با حجـمهـای متفـاوت ۴۹ لايـه نشـانی متفـاوت (۵) R1،	(۵۰) V3. شکل ۴-۷: نمودار ولتاژ- دما (اثر سیبک) برای نمونههای اکسید نیکل خ (۲۰) V1، (۳۰) V2و M1 (۵۰) V3 شکل ۴-۸: تصاویر SEM نمونههای اکسید نیکل خالص با آهنـگهـای (۱۰) R2 و ml/min (۱۵) R3
۴۸ فالص با حجـمهـای متفـاوت ۴۹ الایـه نشـانی متفـاوت (۵) R1 ۵۰	(۵۰) V3. شکل ۴-۷: نمودار ولتاژ- دما (اثر سیبک) برای نمونههای اکسید نیکل خ (۲۰) V1، (۳۰) V2و M1 (۵۰) V3 شکل ۴-۸: تصاویر SEM نمونههای اکسید نیکل خالص با آهنـگهـای (۱۰) R2 و SEM (۱۵) R3 شکل ۴-۹: الگوهای XRD نمونههای NiO خالص تهیه شده با آهنگهـ
۴۸ فالص با حجـمهـای متفـاوت ۴۹ الایـه نشـانی متفـاوت (۵) R1 ۵۰ یای متفـاوت (۵) R1، (۱۰) R2	(۵۰) V3. شکل ۴-۲: نمودار ولتاژ- دما (اثر سیبک) برای نمونههای اکسید نیکل خ (۲۰) V1، (۳۰) V2و M1 (۵۰) V3 شکل ۴-۸: تصاویر SEM نمونههای اکسید نیکل خالص با آهنـگهـای شکل ۴-۹: الگوهای R3 (۱۵) R3 و NiO خالص تهیه شده با آهنگهـ و ml/min (۱۵) R3
۴۸ فالص با حجمهای متفاوت ۴۹ ای با نشانی متفاوت (۵) R1 ۸۰ ۵۰ ۵۱ ۱۰.	(۵۰) V3. شکل ۴-۷: نمودار ولتاژ- دما (اثر سیبک) برای نمونههای اکسید نیکل خ (۲۰) V1، (۳۰) V2و M1 (۵۰) V3 شکل ۴-۸: تصاویر SEM نمونههای اکسید نیکل خالص با آهنـگهـای (۱۰) R2 و SEM (۱۵) R3 شکل ۴-۹: الگوهای XRD نمونههای NiO خالص تهیه شده با آهنگهـ و ml/min (۱۵) R3 شکل ۴-۱۰: طیف عبور اپتیکی لایهها اکسید نیکل خالص برای نمونهه
۴۸ فالص با حجمهای متفاوت ۴۹ ای با آهنگهای لایه نشانی ۵۰ ۵۱ ۵۱ ۵۱ ۵۱ ۵۱ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۳ ۵۳	(۵۰) V3 شکل ۴-۷: نمودار ولتاژ- دما (اثر سیبک) برای نمونههای اکسید نیکل خ (۲۰) V1 (۲۰) V2و Im (۵۰) V3 شکل ۴-۸: تصاویر SEM نمونههای اکسید نیکل خالص با آهنـگهـای شکل ۴-۸: الگوهای SEM نمونههای اکسید نیکل خالص با آهنگهـ شکل ۴-۹: الگوهای XRD نمونههای NiO خالص تهیه شده با آهنگهـ و ml/min (۱۵) ml/min نمونهها اکسید نیکل خالص برای نمونهه متفاوت (۵) R1، (۱۰) R2 و ml/min (۱۵) R3.
 ۴۸ فالص با حجـمهای متفاوت ۴۹ ۳۹ ۲۹ ۲۹	(۵۰) V3 شکل ۴-۷: نمودار ولتاژ- دما (اثر سیبک) برای نمونههای اکسید نیکل خ (۲۰) V1، (۳۰) V2و Im (۵۰) V3 شکل ۴-۸: تصاویر SEM نمونههای اکسید نیکل خالص با آهنـگهـای (۱۰) R2 و SEM نمونههای اکسید نیکل خالص با آهنـگهـای شکل ۴-۹: الگوهای XRD نمونههای NiO خالص تهیه شده با آهنگهـ و mi/min (۱۵) R1. شکل ۴-۱۰: طیف عبور اپتیکی لایهها اکسید نیکل خالص برای نمونهه متفاوت (۵) R1، (۱۰) R2 و mi/min (۱۵) R3.

شکل ۴-۱۲: نمودار تغییرات ضریب جذب بر حسب طول موج برای نمونه های با آهنگ های متفاوت
۵۳R3 (۱۵) ml/min و R2 (۱۰) $R1$ (۵) k1 (۵)
شکل ۴-۱۳: منحنی ² (αhu) بر حسب hv، ب) تغییرات گاف نواری اپتیکی بر حسب آهنگ لایه نشانی
متفاوت ۵، ۱۰ و nl/min و ۱۵ ml/min متفاوت ۵، ۱۰ و
شکل ۴-۱۴: نمودار اثر سیبک نمونههای اکسید نیکل خالص با آهنـگهـای لایـه نشـانی متفـاوت (۵)
۵۵R3 (۱۵) ml/min و R2 (۱۰) $R1$
شکل ۴-۱۵: نمودار I-V لایه های اکسید نیکل خالص با آهنگ های لایه نشانی متفاوت (۵) R1، (۱۰)
۵۵R3 (۱۵) ml/min و R2
شکل ۴-۱۶: تصاویر SEM نمونههای بازپخت شده در هوا با دمای C° ۵۰۰ به مدت ۲h
شکل ۴-۱۷: الگوهای XRD نمونههای بازپخت شده در هوا با دمای $^\circ C$ به مدت XRD نمونههای بازپخت شده در هوا با
شکل ۴-۱۸: طیفهای عبور و بازتاب نمونههای بازپخت شده در هوا با دمای C° ۵۰۰ به مدت ۵۸۲h
شکل ۴-۱۹: طیف ضریب جذب نمونههای بازپخت شده در هوا با دمای C° ۵۰۰ به مدت ۲۴۵۹
شکل ۴-۲۰: منحنی ² (αhv) بر حسب hv برای نمونه های باز پخت شده در دمای C° ۵۰۰ در دمای
۵۹۲h
شکل ۴-۲۱: تصاویر مورفولوژی سطح نمونه های آلایش یافته با کلرید مس با درصدهای وزنی متفاوت
۰٪، ۱٪، ۵٪ و ۱۰٪
شکل ۴-۲۲: نمودارهای پراش پرتو ایکس نمونه های آلایش یافته با کلریـد مـس بـا درصـدهای وزنـی
متفاوت ۰٪، ۱٪، ۵٪ و ۱۰٪
شکل ۴-۲۳: طیفهای عبور و بازتاب نمونههای آلایش یافته با درصدهای وزنی متفاوت مـس ۰٪، ۱٪،
۵٪ و ۱۰٪
شکل ۴-۲۴: نمودار ضریب جذب نمونه های آلایش شده با مس با درصدهای وزنی متفاوت ۰٪، ۱٪،
۵٪ و ۱۰٪

شکل ۴-۲۵: الف) منحنی ² (αhv) بر حسب hv، ب) تغییرات گاف نواری اپتیکی بر حسب میزان
آلایش مس با درصدهای وزنی متفاوت ۰٪، ۱٪، ۵٪و ۱۰٪
شکل ۴-۲۶: نمودار ضریب سیبک برای نمونه های آلایش شده با درصدهای وزنی متفاوت مس ۰٪،
۱٪، ۵٪ و ۱۰٪
شکل ۴-۲۷: نمودار I-V نمونه های آلایش یافته با مس با درصدهای وزنی متفاوت ۰٪، ۱٪، ۵٪ و
۶۷
شکل ۴-۲۸: الگوهای XRD گرفته شده از نمونه های آلایش یافته با درصدهای وزنی متفاوت ۰٪، ۱٪،
۵٪، ۱۰٪ کلرید لیتیم
شکل ۴-۲۹: طیفهای عبور نمونههای آلایش شده با درصدهای وزنی متفاوت لیتیم ۰٪، ۱٪، ۵٪و
۶۹
شکل ۴-۳۰: طیف های بازتاب نمونه های آلایش شده با درصدهای وزنی متفاوت لیتیم ۰٪، ۱٪، ۵ ٪و
۷۰
شکل ۴-۳۱: نمودار ضریب جذب نمونه های آلایش شده با لیتیم با درصدهای وزنی متفاوت ۰٪، ۱٪،
۵٪ و ۱۰٪
شکل ۴-۳۲: لف) منحنی ² (ahv) بر حسب hv، ب) تغییرات گاف نواری اپتیکی بر حسب میزان
آلایش لیتیم با درصدهای وزنی متفاوت ۰٪، ۱٪، ۵٪ و ۱۰٪

جدول ۱-۱: اثر حجم محلول بر ضخامت و خواص لایههای نازک اکسید نیکل[۲۹]۸
جدول ۱-۲: ثابت شبکهها و اندازه متوسط بلور کها در جهت ترجیحی (۱۱۱)[۳۱]
جدول ۱-۳: نتایج بدست آمده از آنالیز XRD نمونههای آلایش یافته[۳۲]
جدول ۱-۴: پارامترهای XRD نمونهها در راستای ترجیحی (۱۱۱)[۳۳]
جدول ۴-۱: مقادیر حاصل از تحلیل داده های XRD در نمونه ها وابسته بـه جهـتگیـری (۱۱۱) بـرای
نمونههای اکسید نیکل با حجمهای متفاوت (۲۰) V1، (۳۰) V2و m۱ (۵۰) V3
جدول ۴-۲: نتایج حاصل از طیف XRD نمونههای خالص تهیه شده با آهنگهای لایه نشانی متفاوت
(۵) R1، (۱۰) R2 و R3 (۱۵) R3.وابسته به قله ترجيحی (۱۱۱)
جدول ۴-۳: نتایج حاصل از طیف XRD نمونه های بازپخت شده در هوا با دمای C° ۵۰۰ بـه مـدت ۲h
وابسته به قله ترجيحي (۱۱۱)
وابسته به قله ترجیحی (۱۱۱)
وابسته به قله ترجیحی (۱۱۱) جدول ۴-۴: مقادیر حاصل از تحلیل داده های XRD در نمونه ها وابسته به جهت گیری (۱۱۱) برای نمونه های آلایش یافته با مس با درصدهای وزنی متفاوت ۰٪، ۱٪، ۵٪ و ۱۰٪
وابسته به قله ترجیحی (۱۱۱) XRD در نمونه ها وابسته به جهت گیری (۱۱۱) برای جدول ۴-۴: مقادیر حاصل از تحلیل داده های XRD در نمونه ها وابسته به جهت گیری (۱۱۱) برای نمونه های آلایش یافته با مس با درصدهای وزنی متفاوت ۰٪، ۱٪، ۵٪ و ۱۰٪ جدول ۴-۵: مقادیر حاصل از تحلیل داده های XRD در نمونه های اکسید نیکل وابسته به فاز بلوری
وابسته به قله ترجیحی (۱۱۱) XRD در نمونه ها وابسته به جهت گیری (۱۱۱) برای جدول ۴-۴: مقادیر حاصل از تحلیل داده های XRD در نمونه ها وابسته به جهت گیری (۱۱۱) برای نمونه های آلایش یافته با مس با درصدهای وزنی متفاوت ۰٪، ۱٪، ۵٪ و ۱۰٪
وابسته به قله ترجیحی (۱۱۱) XRD در نمونه ها وابسته به جهتگیری (۱۱۱) برای جدول ۴-۴: مقادیر حاصل از تحلیل داده های XRD در نمونه ها وابسته به جهتگیری (۱۱۱) برای نمونه های آلایش یافته با مس با درصدهای وزنی متفاوت ۰٪، ۱٪، ۵٪ و ۱۰٪

ف

۱ فصل اول

مروری بر مقالات و مقدمه ای برویژنی پی

ساختاري، الكتريكي واپنيكي لايه اي نارك اكسد شكل

مقدمه

ل اول

هنگامی که پژوهشگران برای اولین بار با نیمرساناها مواجه شدند، اگر چه تقسیم بندی کاملاً مشخصی از فلزات و عایقها وجود داشت لکن مواد نیمرسانای جدید را نمی توانستند در هیچ کدام از این دو گروه جای دهند تا اینکه معلوم شد نیمرساناها از لحاظ نحوه هدایت با فلزات متفاوت هستند. بعد از مدتی معلوم شد که قطعات وابسته به این مواد از مصرف انرژی فوق العاده کم و ابعاد کوچک و تکرارپذیری بالایی برخوردارند[۱]. یکی از این نیمرساناها که در سال های اخیر به عنوان یکی از نیمرساناهای دوستدار طبیعت شناخته شده است اکسید نیکل می باشد[۲]. ما در این پایانامه ابتدا به معرفی این ماده، کاربردهای آن در فیزیک لایه های نازک و سپس به بررسی خواص ساختاری و اپتیکی این ماده به روش اسپری پایرولیزیز می پردازیم.

۱–۱ اکسید نیکل

کوشش های مداوم برای جدا کردن مس از کانی مخصوصی که به ظاهر شبیه مـس بـود و بـرای معدن داران آلمانی بسیار معروف بود، ناموفق ماند. تا اینکه در سال ۱۷۵۱ کرونشتد از سوپد ایـن کـانی را آزمایش کرد و موفق شد یک اکسید فلزی سبز رنگ از این کانی تهیه کند که نام آن را اکسید نیکل (NiO) نامید. این ماده را با نام های دیگری مثل مونو اکسید نیکل ⁽ و اکسو نیکل ^۲ نیز می شناسند [۳].

۱-۱-۱ ساختار اکسید نیکل

اکسید نیکل دارای ساختار مکعبی شبیه نمک طعام (NaCl) است (شکل ۱–۱) که دارای ثابت شبکه ۴/۱۸۱۱ Å میباشد. مانند بسیاری از اکسیدهای فلزی دوتایی دیگر NiO اغلب دارای تناسب عنصری⁷ نیست یعنی نسبت Ni:O بصورت ۱:۱ نیست که با فرمول Ni_{1-δ}O نشان داده میشود بطوری که δ در محدوده ۰ تا ^{۳-}۱۰×۵ است. همان طورکه δ کاهش مییابد اکسید نیکل از رنگ سیاه به رنگ

¹Nickel monoxide

²Oxonickel

³Stoichiometry